

原子スケールにおける 異種材界面の応力場・ひずみ場評価

鹿児島大学大学院 理工学研究科機械工学専攻 固体力学研究室修士課程2年 芝健太

- 研究背景•目的
- 解析理論
 - -異方性弾性論
 - -原子シミュレーション理論
- 解析条件・結果
 -分子静力学解析による応力場・ひずみ場
 -MS解と弾性解の比較
- 結言

- 研究背景•目的
- 解析理論
 - -異方性弾性論
 - -原子シミュレーション理論
- 解析条件・結果
 -分子静力学解析による応力場・ひずみ場
 -MS解と弾性解の比較
- 結言



・ 積層されている電子デバイスのほとんどは異方性材料

原子スケールにおける 異方性異種材界面の応力場・ひずみ場の評価が重要

<u>材料定数の違いにより応力が集中する原因</u>



<u>材料定数の違いにより応力が集中する原因</u>



<u>材料定数の違いにより応力が集中する原因</u>





ミスフィット転位とは・・・

異種材間の格子定数が異なることが原因で生じる 弾性ひずみを緩和させるため,界面に周期的に発生する転位



[1] A. Jallipalli, et al., Nanoscale research letters (2009).

先行研究

森山らが仮想モデルにおける異方性異種材界面・角部で,

- 分子静力学解析より、ミスフィット転位が破壊靭性値に 及ぼす影響を評価
- 分子静力学法(MS法)と異方性弾性解の結果を比較し、
 格子定数差が小さいときは両者が比較的一致していたと、
 と、ミスフィット転位の影響を評価^[2]





実材料に生じるミスフィット転位の応力場・ひずみ場を

弾性論と解析から定量的に評価

→積層材料の信頼性向上を図る

[2] 森山真樹, ミスフィット転位が存在する異方性異種材界面および界面角部の応力・ひずみ場, 京都大学修士論文, (2014).

評価方法



[3] C. Hwu, Anisotropic Elastic Plates, Springer Science+Business Media, (2010), pp. 53-113.

- ·研究背景·目的
- 解析理論

-異方性弾性論

-原子シミュレーション理論

- 解析条件・結果
 -分子静力学解析による応力場・ひずみ場
 -MS解と弾性解の比較
- 結言



整合面における応力(異方性弾性論)







- 研究背景•目的
- 解析理論

-異方性弾性論

-原子シミュレーション理論

- 解析条件・結果
 -分子静力学解析による応力場・ひずみ場
 -MS解と弾性解の比較
- 結言

分子静力学法(原子シミュレーション理論)

- 原子間のポテンシャルによって相互作用する質点で近似し、 構造緩和を行うことで系全体のポテンシャルエネルギーを最 小化することで系の特性や物性を求めることができる。
- 0Kでの分子動力学法に対応し,静的に原子構造を取り扱う.
 →理想的な系での計算を行うことができる.



原子間ポテンシャル(原子シミュレーション理論)

原子間ポテンシャル \rightarrow Stillinger-Weberポテンシャル^[4]を使用

→ 二体間ポテンシャルに三体間ポテンシャルを付加した形で表現されるポテン → シャルエネルギーで, ダイヤモンド構造のパラメータにフィッテングしている.



[4] Frank H. Stillinger and Thomas A. Weber, Computer simulation of local order in condensed phases of silicon, Physical Review B, Vol. 31, Num. 8, (1985), 5262.

原子間ポテンシャル(原子シミュレーション理論)

• 二体間ポテンシャル

$$v_{2}(r_{ij}) = \varepsilon f_{2}(r_{ij} / \sigma)$$

$$f_{2}(r) = \begin{cases} A(Br^{-p} - r^{-q}) \exp[(r - a)^{-1}], & r < a \\ 0, & r \ge a \end{cases}$$

● 三体間ポテンシャル

$$v_{3}(\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{j},\mathbf{r}_{k}) = \varepsilon f_{3}(\mathbf{r}_{i} / \sigma,\mathbf{r}_{j} / \sigma,\mathbf{r}_{k} / \sigma)$$

$$f_{3}(\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{j},\mathbf{r}_{k}) = h(r_{ij},r_{ik},\theta_{jik}) + h(r_{ji},r_{jk},\theta_{ijk}) + h(r_{ki},r_{kj},\theta_{ikj})$$

$$h(r_{ij},r_{ik},\theta_{jik}) = \lambda \exp[\gamma(r_{ij} - a)^{-1} + \gamma(r_{ik} - a)^{-1}] \times (\cos\theta_{jik} + \frac{1}{3})^{2}$$

$$\varepsilon(eV) : 結合 \pm \lambda \nu \mp - \sigma$$

$$\sigma(A) : 原子間距離 \varepsilon$$

$$\varepsilon to \gamma = \delta r^{3} + 2 \delta r^{$$

カの応力変換式

 $f_i^{\alpha} = -\frac{\partial \Phi}{\partial r_i^{\alpha}} \quad \Phi = \sum_i \sum_{j>i} v_2(i,j) + \sum_i \sum_{j>i} \sum_{k>j} v_3(i,j,k)$ カ/を以下の式で応力に変換 $\sigma_{ij} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial (K + \phi)}{\partial \varepsilon_{ii}} \right) = -\frac{1}{V} \left(\sum m^{\alpha} v_i^{\alpha} v_j^{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial \phi}{\partial r^{\alpha\beta}} \frac{\partial r^{\alpha\beta}}{\partial \varepsilon_{ii}} \right)$ $= -\frac{1}{V} \left(\sum_{\alpha} m^{\alpha} v_{i}^{\alpha} v_{j}^{\alpha} + \sum_{\alpha \neq \ell} (r_{i}^{\alpha} - r_{i}^{\beta}) f_{j}^{\alpha\beta}\right)$ $\sigma_{ij}^{\alpha} = -\frac{1}{V^{\alpha}} (m^{\alpha} v_i^{\alpha} v_j^{\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N_p} (r_i^{\alpha} f_j^{\alpha\beta} + r_i^{\beta} f_j^{\beta\alpha}))$ ひずみ変換

 $K: 運動エネルギー m: 質量 v: 速度 <math>V_{\alpha}: 原子\alpha$ の体積 $N_{p}^{\alpha}: 原子\alpha$ の配位数 $\sigma_{ij}: 系全体の応力 \sigma_{ij}^{\alpha}: 原子\alpha$ の応力

応力のひずみ変換式		C_{11} (GPa)	C_{12} (GPa)	<i>C</i> ₄₄ (GPa)
	Si ^[5]	166	63.9	79.6
	Ge ^[5]	129	48.3	66.8

分子静力学解析から得られた応力場をひずみ場に変換する方法としてHooke's法則 を使用した. σ:応力

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

これをとについて解くと

$$\mathcal{E}_{ij} = S_{ijkl} \sigma_{kl}$$
 S:弾性コンプライアンス

C:弾性スティフネス

ε:ひずみ

SiやGeのような立方晶を持つ材料は, S_{11} , S_{12} , S_{44} の弾性スティフネスから表される

 $\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & S_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & S_{44} & 0 & 0 \\ & Sym. & S_{44} & 0 \\ & & S_{44} & 0 \\ & & & S_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} \end{bmatrix}$

[5] R. Srinivasan, Lattice theory of third order elastic constants of Germanium and Silicon, *J. Phys. Chem. Solids* Pergamon Press, Vol. 28, (1967), pp. 2385-2369.

- 研究背景•目的
- 解析理論
 - -異方性弾性論

-原子シミュレーション理論

- 解析条件•結果
 - -分子静力学解析による応力場・ひずみ場 -MS解と弾性解の比較
- 結言



[6] Zi Jian, Modification of Stillinger-Weber potentials for Si and Ge, Physical Review B, Vol. 41, Num. 18, (1990), 12915.





- ・ ミスフィット転位の発生による応力集中(Ge側で引張力, Si側で圧縮力)が発生。
- 転位近傍以外の界面では、ミスフィット転位に作用した応力を緩和するためにGe側で圧縮力、Si側で引張力が生じていた。
- 界面上ではクロス上に転位線が生じていた.





- ミスフィット転位の影響による応力振幅が発生している
- ミスフィット転位近傍では±7GPaほど,転位線上には±5GPaほどの応力が作用している
- 分子静力学のような理想的な系での計算では、ミスフィット転位が約14nm毎に発生する

解析結果(MS解によるひずみ場)



- ミスフィット転位近傍では±3~4%ほど、転位線上には±2~2.5%ほどのひずみが作用している
- SiよりもGeのほうがひずみ量が大きい(ヤング率の影響によるもとだと考えられる).



- ミスフィット転位近傍では±3~4%ほど、転位線上には±2~2.5%ほどのひずみが作用している
- SiよりもGeのほうがひずみ量が大きい(ヤング率の影響によるもとだと考えられる).

- 研究背景•目的
- 解析理論
 - -異方性弾性論

-原子シミュレーション理論

- 解析条件•結果
 - -分子静力学解析による応力場・ひずみ場

-MS解と弾性解の比較

結言



解析結果(MS解と弾性解の比較)



・分子静力学解析と弾性解の結果が定性的に一致している.





- 研究背景•目的
- 解析理論
 - -異方性弾性論
 - -原子シミュレーション理論
- 解析条件・結果
 -分子静力学解析による応力場・ひずみ場
 -MS解と弾性解の比較
- 結言

結言

分子静力学解析を用いて,格子定数差4.1%を持つGe/Si界面 に発生するミスフィット転位近傍の応力場・ひずみ場を評価した. 以下に得た知見を示す.

- 分子静力学のような理想的な系での計算では、ミスフィット転位による応力集中が発生し、Ge側で引張力、Si側で圧縮力が作用していた。
- ミスフィット転位近傍には、応力が約±7GPa、ひずみに換算すると約±3~4%作用していた。
- MS解と弾性解を比較し,転位芯近傍以外で誤差が1GPa程 度であり,応力場が比較的一致していた.